PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-160056

(43) Date of publication of application: 13.06.2000

(51)Int.CI.

CO9D 1/00 B01J 19/00 B01J 21/06 B01J 35/02 C03C 17/23

C09D183/04 C09K 3/18

(21)Application number : 11-269086

(71)Applicant: TOTO LTD

(22)Date of filing:

22.09.1999

(72)Inventor: TOYOFUKU SHINJI

KOJIMA SHIGERU TAKASHIO MINORU

TAKEDA KOJI

HIRAKAWA TOMOHIRO

(30)Priority

Priority number: 10285974

Priority date : 22.09.1998

Priority country: JP

(54) PHOTOCATALYTIC COATING COMPOSITION, PHOTOCATALYTIC COMPOSITE MATERIAL AND PREPARATION OF PHOTOCATALYTIC COMPOSITE MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a coating composition having chemical resistance, mechanical strength and photocatalytic activities and excellent in coatability by highly dispersing an inorganic oxide in an aqueous photocatalyst dispersion sol.

SOLUTION: As an aqueous dispersion sol of a photocatalyst is employed a TiO2 sol. An inorganic oxide added to the photocatalytic coating composition is the one easily soluble as a metal ion in water and examples thereof are ceria, zirconia, alumina, amorphous titanium oxide, tin oxide, magnesia, calcia, yttria, manganese oxide and the like. Addition of zirconia among others improves chemical resistance, photoactivity and water resistance. The inorganic oxide is highly dispersed preferably by adding a raw material thereof, as a metal ion, to an aqueous photocatalyst dispersion sol. Further, silica and/or a silicone with at least a part of its organic groups bonded to silicon atoms replaced by a hydroxy group is preferably incorporated into the photocatalytic coating composition.

Searching PAJ Page 2 of 2

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出銀公開登号 特開2000-160056 (P2000-160056A)

(43)公開日 平成12年6月13日(2000.6.13)

(51) Int.CL'	織別配号	FΙ	チーマコード(参考)
C09D 1/00		C09D 1/00	
B 0 1 J 19/00		B01J 19/00	K
21/06		21/06	M
35/02		35/02	J
C03C 17/23		CO3C 17/23	
	李喆亞審	未請求 前求項の数	OL (全 7 頁) 最終頁に続く
(21)出顯番号	特顧平11−269086	1	010087 段機器 体 式会社
(22)出版日	平成11年9月22日(1999.9.22)	扬P 号	现以北九州市小倉北区中島2丁目1番1
(31)優先概主張番号	特勝平10-285974	(72)発明者 豊福	宮 信次
(32)優先日	平成10年9月22日(1998.9.22)	続き	现北九州市小倉北区中島2丁目1番1
(33)優先権主張国	日本 (J P)	号	東陶機器株式会社内
		(72)発明者 小島	5 茂
		福岡	明末九州市小倉北区中島2丁目1番1
		号	東西機器株式会社内
		(72)発射者 高雄	I &
		福	明果北九州市小倉北区中島2丁目1番1 東陶機器株式会社内
		Ì	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光触媒性コーティング組成物、光触媒性複合材および光触媒性複合材の製造方法

(57)【要約】

【課題】 本発明は、耐薬品性及び機械的強度 更には 光触媒活性を保持し、塗工性に優れた光触媒性コーティ ング組成物を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明は、水系光無媒分散ゾルに無機酸 化物が高分散化させた光触媒性コーティング組成物を提 供する。 (2)

【特許請求の範囲】

【韻求項1】 水系光触媒分散ゾルに無機酸化物を高 分散化させてなることを特徴とする光触媒性コーティン グ組成物。

1

【請求項2】 前記水系光触媒分散ゾルは、TiO。 であることを特徴とする語求項1に記載の光触媒性コー ティング組成物。

【請求項3】 前記無機酸化物は、セリア、ジルコニ ア、アルミナ、無定型酸化チタン、酸化鋁、マグネシ ア、カルシア、イットリア、酸化マンガン、クロミア、 酸化パナジウム、酸化銅、酸化コパルト、酸化ニッケ ル、酸化ルテニウム、ハフニア、酸化ストロンチウム、 酸化銀の群から選ばれる 1 種又は2 種以上等であること を特徴とする語求項1又は2に記載の光触媒性コーティ ング組成物。

【請求項4】 さらにシリカ及び/またはケイ素原子 に結合する有機基の少なくとも一部が水酸基に置換され たシリコーンを含有することを特徴とする請求項1~3 に記載の光触媒性コーティング組成物。

【請求項5】 前記無機酸化物の高分散化は、無機酸 20 化物の原料を金属イオンとして水系光触媒分散ゾルに添 加させたことを特徴とする請求項1~4に記載の光無線 性コーティング組成物。

基材表面に請求項1~5の光触媒性コ 【諸求項6】 ーティング組成物を用いて形成された被膜を有する光触 媒性複合材。

【語求項7】 請求項6の光触媒性複合材の製造方法 であって、請求項1~5の光触媒性コーティング組成物 を塗布し、熱処理または自然乾燥により硬化させ被膜を 形成することを特徴とする光触媒性複合材の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、鏡、レンズ、ガラ ス、金属、セラミックなどの各種基村の裏面に防煙性、 防汚性、抗菌性および汚れを分解する機能を有する光触 媒性コーティング組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】最近の防汚材料として光触媒を有する材 料が利用されているが、従来の方法で作成された光触媒 性組成物は、耐薬品性が低く、該当試験を行うと膜が剝 40 離してしまうという不具合が発生していた。そこで耐薬 品性を向上させるために2ェ元素化合物を含んだ光絵媒 性組成物 (特開平9-328336) が提案されてい る。この方法では、TIOz源としてアルコール系分散 Ti. 2 r 源として、ジルコニウムアセテート化合物、 ジルコニウムキレート化合物等を用いた光触媒性組成物 を作成し、耐薬品性の向上を真現している。

[0003]

【発明の解決すべき課題】しかしながら、前記方法で

ムアセテート化合物を添加した場合、溶液中に凝集また は、沈澱が発生することから基材にコーティングした場 台に外観、耐薬品性、機械的強度等における要求品質を 満たせない場合が発生し、更には製品の多図まりが低下 するという問題がある。従って、本発明は、上記事情に 鑑み、耐薬品性及び機械的強度、更には光触媒活性を保 持し、塗工性に優れた光触媒性コーティング組成物を提 供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため になされた請求項第1項記載の発明は、水系光触媒分散 ゾルに無機酸化物が高分散化された光触媒性コーティン グ組成物を提供する。請求項第2項記載の発明は、前記 水系光触媒分散ゾルは、TiO2であることを特徴とす る調水項1に記載の光無媒性コーティング組成物を提供 する。請求項第3項記載の発明は、前記無機酸化物は、 セリア、ジルコニア、アルミナ、無定型酸化チタン、酸 化錦、マグネシア、カルシア、イットリア、酸化マンガ ン、クロミア、酸化パナジウム、酸化銅、酸化コパル **卜.酸化ニッケル、酸化ルテニウム.ハフニア.酸化ス** トロンチウム、酸化銀の群から選ばれる1種又は2種以 上等であることを特徴とする請求項 1 又は2 に記載の光 触媒性コーティング組成物を提供する。請求項第4項記 戯の発明は、更にシリカ及び/またはケイ素原子に結合 する有機基の少なくとも一部が水酸基に置換されたシリ コーンを含有することを特徴とする語求項1~3に記載 の光触媒性コーティング組成物を提供する。本発明によ れば、光触媒性コーティング組成物により形成された彼 膜を有する基付表面において、光励起に応じて生じる親 30 水化はより高度に造むようになると共に、一旦親水化さ れた基材を暗所に放置した場合でも、長期にわたり親水 性が維持されるようになる。請求項第5項記載の発明 は、無機酸化物の原料が金属イオンとして水系光触媒分 散ゾルに添加されたことを特徴とする無機酸化物の高分 飲化を提供する。本発明によれば、水系光触媒分散ゾル に無機酸化物の元を金属イオンとして添加することによ り、凝集・推顧の発生がなくなり、無機酸化物が分子レ ベルで高分散化されたコーティング組成物が得られる。 請求項第6項記載の発明は、請求項1~5の光触媒性コ ーティング組成物を用いて形成された铵膜を有する光触 雄性複合材を提供する。 語求項第7項記載の発明は、請 求項6の光触媒性複合材の製造方法であって、請求項1 ~5の光鮭媒性コーティング組成物を塗布し、熱処理、 または、自然乾燥により硬化させ彼膜を形成することを 特徴とする光触媒性複合材の製造方法を提供する。

[0005]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の彩盤を詳細 に説明する。本発明における光触媒とは、光触媒性酸化 物をいい、酸化物結晶の任導電子帯と偏電子帯との間の は、水系光触媒分散ゾルに無機酸化物としてジルコニウ 50 エネルギーギャップよりも大きなエネルギー(すなわち

短い波長)の光(励起光)を照射したときに、価電子帯 中の電子の励起 (光励起) によって、伝導電子と正孔を 生成しうる酸化物をいい、アナターを型酸化チタン、ブ ルッカイト型酸化チタン、ルチル型酸化チタン、酸化 **錫、酸化亜鉛、三酸化二ピスマス、三酸化タングステ** ン、酸化第二鉄、チタン酸ストロンチウムの群から選ば れる1種又は2種以上等が使用できる。

3

【0006】本発明の光触媒性コーティング組成物にシ リカ及び/又はケイ素原子に結合する有機基の少なくと とにより、光触媒性コーティング組成物により形成され た核膜を有する基材表面において、光励起に応じて生じ る親水化はより高度に造むようになると共に、一旦親水 化された基材を暗所に放置した場合でも、長期にわたり 観水性が維持されるようになる。本発明の光触媒性コー ティング組成物に用いるシルカ及び/ケイ素原子に結合 する有機基の少なくとも一部が水酸基に置換されたシリ コーンとしては、加水分解性シラン、アルキルシリケー ト、それらの(部分)加水分解物、加水分解・総合物な どが使用できる。ここで加水分解性ンランとしては、メ 20 2 r P、2 r S 2 等が示される化合物、酸化敷が0の チルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、 メチルトリエトキシシラン。エチルトリエトキシシラ ン、メチルトリプロポキシシラン、エチルトリプロポキ シシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロ ピルトリエトキシシラン。n-プロピルトリプロポキシ シラン、イソプロピルトリメトキシシラン、イソプロピ ルトリエトキシシラン、イソプロピルトリプロポキシシ ラン、メチルトリプトキシシラン、エチルトリプトキシ シラン、n-プロピルプトキシシラン、イソプロピルブ トリエトキシシラン、フェニルトリプロポキシシラン、 フェニルトリプトキシシラン、ャーグリシドキシプロピ ルトリメトキシシラン、ケーグリシドキシプロビルトリ エトキシシラン、アーグリンドキシプロピルトリプロポ キシシラン、ァーメタクリロキシプロビルトリメトキシ シラン、アーメタクリロキンプロビルトリエトキシシラ ン、テーメタクリロキシプロピルトリプロポキシシラ ン、8- (3、4-エポキシシクロヘキシル) エチルト リメトキシシラン、8-(3、4-エポキシシクロヘキ トリメトキシシラン、アーアミノプロビルトリエトキシ シラン、アーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、 **ャーメルカプトプロピルトリエトキシシラン、トリフル** オロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピ ルトリエトキシシラン、フェニルメチルジエトキシシラ ン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジェトキシシ ラン、ジエチルジエトキシシラン、フェニルメチルジメ トキンシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニ ルジエトキシンラン等の加水分解性オルガノシラン、テ

トラロープロポキシシラン、アトラブトキシシラン、ア トラメトキシシラン、ジメトキシジエトキシシラン等の テトラアルコキシシランなどが使用できる。アルキルシ リケートとしては、メチルシリケート。エチルシリケー ト、プロピルシリケート、プチルシリケートなどが使用 できる。

【0007】本発明の光触媒性コーティング組成物に添 加できる無機酸化物としては、水に金属イオンとして溶 けやすいものであり、セリア、ジルコニア、アルミナ、 も一部が水酸基に置換されたシリコーンが含有されるこ 10 标定型酸化チタン、酸化鋁。マグネシア、カルシア、イ ットリア、酸化マンガン、クロミア、酸化パナジウム、 酸化銅、酸化コバルト、酸化ニッケル、酸化ルテニウ ム、ハフニア、酸化ストロンチウム、酸化銀の群から選 ばれる1種又は2種以上等が挙げられる。上記の無機酸 化物は充填剤として被膜の強度を向上させる。さらに、 このうちジルコニアを添加すると耐薬品性、光活性及び 耐水性が向上する。ジルコニアを含む化合物として一般 に知られているジルコニム化合物には、酸化数が特定し にくい2rHz、2rB、2rC、2rSiz、ZrN、 $[Zr\{P(CH_i)_i\}(n^e-h\mu x\nu)_i], [2r$ (C_a)₂ (η¹ – C₃H_a)₂]、酸化敷が1の2 r C l 、 酸化敷が2の2rX_x(X=C1.Br、I)、酸化敷 が3の2 r X, (X=F、C 1. B r、 i) 等、酸化敷 が4のジルコニウム化合物であるジルコン2 rSiO, や、ハロゲン化ジルコニウムである2xX。(X=F. C1. Br、I)、2rOz等のジルコニア、2rO 。(OH)。(m=4-n: 4≥n≥0の整数)のオキソ 酸ジルコニウム、M.ZrO、、M.ZrO、(M=Na、 トキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニル 30 K、1/2Ca.1/2Pb〉等のジルコン酸塩、硝酸 ジルコニウム、硫酸ジルコニウム、水酸化ジルコニウ ム. [2 r F。] **. [2 r F。] **等のフッ化ジルコニ ウムのフルオロ錯体、また、俗にジルコニルと呼ばれる 2 r Oで表される+2価の原子団のオキシ塩化ジルコニ ウム、オキシ水酸化ジルコニウム、オキシ硝酸ジルコニ ウム等があり、さらに、加水分解・重福合反応で得られ るZr (OCH,)。のようなジルコニウムアルコキシド などがある。ジルコニウム化合物は、他のケイ素、チタ ン、アルミニウムといった無機化合物の中でも耐酸性、 シル)エチルトリエトキシシラン、ァーアミノブロビル 40 耐水性、耐アルカリ性が特に良いと言われる化合物であ る。しかし、アルコキシド等からの加水分解・重福合反 応は、他のものと比べてもかなり速く、溶媒中で凝集す るなどの現象が起こりやすく、扱いにくい案材でもあ る。本発明に用いられるジルコニウム化合物は、前記ジ ルコニウム化合物の中のジルコニルと、硝酸ジルコニウ ム、確敵ジルコニウム、ハロゲン化ジルコニウム等が好 適に用いられる。前記ジルコニルには、オキシ塩化ジル コニウム、オキン水酸化ジルコニウム、オキシ硝酸ジル コニウムがあり、おのおのZrOCla、ZrO(O トラエトキシンラン、テトライソプロポキシシラン、テ 50 H) ;、2 r Q (NO,) ;のような化学式で表される

が、 Zェ= 〇のような2重結合は存在せず、 - Zェ - 〇 - Zr - の高分子鎖を構成する複雑な構成で形成されて いる。塩化ジルコニウムは、「2 r C 1。」の連なった 鎖状構造を待っており、容易にオキシ塩化ジルコニウム になる傾向がある。そのため、この試薬自体耐アルカリ 性面等で、オキシ塩化ジルコニウムと同等の性能があ る。硝酸ジルコニウムは、2 r (NO,) として表せち れるが、乾燥空気中では、徐々に硝酸を開放してオキシ 硝酸ジルコニウムに変化している。その為、通常の市販 品は、この状態で存在する。硫酸ジルコニウムは、2m (SO1), · 4H, Oとして安定に存在する。本発明に 用いられるジルコニウム化合物としては、前記試薬のほ かに、ジルコニルの一つであるオキシ酢酸ジルコニウ ム、オキシ硫酸ジルコニウムや、硝酸ジルコニウムの一 つである2 r (OH) , (NO,) , · 4 H,O、ZrO $(NO_1)_2$, Zr_2O_2 $(NO_2)_2$, Zr_4O_7 $(NO_2)_2$ 等や、酢酸ジルコニウム、さらに、フッ化ジルコニウ ム、臭化ジルコニウム、ヨウ化ジルコニウム等が好適に 用いられる。また、アルミナ、セリア、イットリアを添 加すると暗所親水維持性が向上する。また酸化ルテニウ 20 ム、酸化銅を添加すると酸化還元力が向上する。また、 酸化銀、酸化銅を添加すると抗菌性が向上する。

【①①08】本発明の光触媒性コーティング組成物の表 面層には、銀、銅、パラジウム、白金、ロジウム、ブラ チウム、ルテニウム、金、亜鉛、コバルト、鉄、ニッケ ル、ナトリウム、リチウム、ストロンチウム、カリウ ム、カルシウム、マグネシウム又はそれら金属の化合物 の群から選ばれる1種以上を添加してもよい。銀、銅、 亜鉛又はそれら金属の化合物の群から選ばれる1種以上 を添加することで、抗菌性を付与することができる。 【0009】パラジウム、白金、ロジウム、プラチウ ム、ルテニウム、金、コバルト、鉄、ニッケル又はそれ **ら金属の化合物の群から選ばれる1種以上を添加するこ** とで、光半導体の光励起による酸化還元触媒性能を向上 させることができる。ナトリウム、リチウム、ストロン チウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム又はそれ **ら金属の化合物の群から遺ばれる1種以上を添加するこ** とで、光半導体の光励起に応じた親水化性能を向上させ ることができる。

グ剤 (分散剤)を添加する方法および無機酸化物の原料 を金属イオンとして添加する方法が挙げられる。前記、 分散剤を用いる方法は、分散したい溶質(無機酸化物) とそれが添加される密媒の種類により、それに適した分 **歓劇を選定する必要がある。しかしながら、その組み合** わせは、多様にわたり、その中から最適な分散剤を選定 するのは、難しく、分散剤が適さない場合、社殿・経集 が発生し、塗工性に悪影響を及ぼすことになる。

【0011】無機酸化物の原料を金属イオンとして添加 する場合は、分子レベルでの分散が可能になり、分散剤 50 用可能な基材としては、防癌効果を期待する場合には透

を利用する場合に比べ、より高分散化が実現可能であ

【①①12】本発明の光触媒性コーティング組成物の形 成方法としては、例えば光触媒性酸化チタン粒子を分散 した塗布液を調整し、前記塗布液を基材表面上にスプレ ーコーティング法、ディップコーティング法、フローコ ーティング法。スピンコーティング法。ロールコーティ ング法、バーコート法、刷毛塗り、スポンジ塗り等の方 法で塗布し、熱処理、室温放置、紫外線照射等により盒 10 合させて表面層を基材に固定する。上記方法で部村表面 に盆膜を形成すると、部村表面は光触媒の光励起に応じ て親水性を呈するようになる。ここで、光触媒の光励起 により、基材表面が高度に親水化されるためには、励起 光の照度は①、①①1mW/cm*以上あればよいが、 0.01mW/cm⁴以上だと好ましく、0.1mW/ cm¹以上だとより好ましい。光触媒性酸化物が、アナ ターゼ型酸化チタン、ルチル型酸化チタン、酸化亜鉛、 チタン酸ストロンチウムの場合には、光触媒の光励起に 用いる光源としては、太陽光、室内照明、蛍光灯、水銀 - 灯、白熱電灯、キセノンランプ、高圧ナトリウムラン プ、メタルハライドランプ、BLBランプ等が好適に利 用できる。また、光触媒性酸化物が酸化器の場合には、 殺菌灯、BLBランプ等が好適に利用できる。

【0013】光触媒性コーティング組成物表面が水との 接触角にて10、以下、好ましくは5、以下の状態を維 待するようであれば、以下のような防鬱効果が発揮され る。空気中の湿分や湯気が結算しても、経縮水が個々の 水滴を形成せずに一様な水膜になる傾向が顕著になる。 従って、表面に光散乱性の曇りを生じない傾向が顕著に 30 なる。同様に 窓ガラスや車両用バックミラーや車両用 風防ガラスや眼鏡レンズやヘルメットのシールドが降雨 や水しぶきを浴びた場合に、離散した目降りな水滴が形 成されずに、高度の視界と可視性を確保し、真両や交通 の安全性を保証し、種々の作業や活動の能率を向上させ る効果が飛躍的に向上する。

【10114】光触媒性コーティング組成物表面が水との 接触角にて30、以下、好ましくは20、以下の状態を 維持するようであれば、以下のような表面洗浄効果が発 **掉される。都市旗座、自動車等の排気ガスに含有される** 【0010】無機酸化物の分散化方法として、レベリン(40)カーボンブラック等の燃練生成物、油脂、シーラント溶 出成分等の導水性汚染物質、及び無機钻土質汚染物質双 方が付着しにくく、付着しても降雨や水洗により簡単に 落せる状態になる。光触媒性コーティング組成物表面が 上記高度の観水性を呈し、かつその状態を維持するよう になれば、帯電防止効果(ほこり付着防止効果)。断熱 効果、水中での気泡付着防止効果、熱交換器における効 率向上効果、生体観和性向上効果等が発揮されるように

【①①15】本発明の光触媒性コーティング組成物が適

明な墓材であり、その材質はガラス、プラスチック等が 好酒に利用できる。適用可能な基材を用途でいえば、草 両用後方確認ミラー、浴室用鏡、洗面所用鏡、歯科用 鏡、道路鏡のような鏡;眼鏡レンズ、光学レンズ、照明 用レンズ、半導体用レンズ、彼写機用レンズ、車両用後 方確認カメラレンズのようなレンズ、プリズム、建物や 監視塔の窓ガラス:自動車、鉄道車両、航空機、船舶、 潜水廠、督上車、ロープウエイのゴンドラ、遊園地のゴ ンドラ、宇宙船のような乗物の窓ガラス;自動車。オー トバイ、鉄道車両、航空機、船舶、潜水艇、雪上車、ス 10 ノーモービル。ロープウエイのゴンドラ、遊園地のゴン ドラ、宇宙船のような最物の風防ガラス:防護用ゴーグ ル、スポーツ用ゴーグル、防護用マスクのシールド、ス ボーツ用マスクのシールド、ヘルメットのシールド、冷 凍食品随列ケースのガラス 中華饅頭等の保温食品の随 列ケースのガラス: 計測機器のカバー 車両用後方確認 カメラレンズのカバー、レーザー歯科治療器等の集束レ ンズ、車間距離センサー等のレーザー光検知用センサー のカバー、赤外線センサーのカバー;カメラ用フィルタ - 及び上記物品表面に貼着させるためのフィルム、シ 20 ート、シール等を含む。

7

【①①16】本発明の光触媒性コーティング組成物が適 用可能な基材としては、表面清浄化効果を期待する場合 にはその材質は、例えば、金屑、セラミック、ガラス、 プラスチック、木、石、セメント、コンクリート、繊 維、布帛、それらの組合せ、それらの積層体が好適に利 用できる。適用可能な基材を用途でいえば、建材、建物 外鏡、建物内鏡、窓枠、窓ガラス、構造部材、乗物の外 要及び塗装、機械装置や物品の外装。 防魔カバー及び塗 、 交通標識、各種表示装置、広告塔、道路用途音壁、 鉄道用遮音壁、橋梁、ガードレールの外装及び塗装、ト ンネル内装及び塗装、碍子、太陽電池カバー、太陽熱温 水器集熱カバー、ビニールハウス、車両用照明灯のカバ - 佐宅設備、侵器、浴槽、洗面台、照明器具、照明カ バー、台所用品、食器、食器洗浄器、食器乾燥器、液 し、調理レンジ、キッチンフード、換気扇、及び上記物 品表面に貼着させるためのフィルム。シート、シール等 を含む。

【0017】本発明の光触媒性コーティング組成物が適用可能な基材としては、乾燥促進効果を期待する場合に 40 はその材質は、例えば、金属、セラミック、ガラス、ブラスチック、木、石、セメント、コンクリート、微維、布帛、それらの組合せ、それらの領層体が好適に利用できる。適用可能な基材を用途でいえば、自動車車体、窓、舗道及び上記物品衰面に貼着させるためのフィルム、シート、シール等を含む。本発明の光無媒性コーティング組成物が適用可能な基材としては、帯電防止効果を期待する場合にはその材質は、例えば、金属、セラミック、ガラス、プラスチック、木、石、セメント、コンクリート、繊維、布帛、それらの組合せ、それらの積層 50

体が好適に利用できる。適用可能な基材を用途でいえば、ブラウン管、磁気配録メディア、光記録メディア、光記録メディア、光記録メディア、光記録メディア、光記録メディア、光記録メディア、光記録メディア、光記録メディア、光記録メディア、光記録メディア、アナログレコード、家庭用電気製品のハウジングや部品や外装及び塗装、住材、建物外装、建物内装、窓枠、窓がラス、構造部材、景物の外装及び塗装、侵板装置や物品の外装、防虚カバー及び塗装、及び上記物品表面に貼着させるためのフィルム、シート、シール等を含む。【0018】

【実施例】実施例1

エチルシリケート(コルコート社製エチルシリケート4 0. 溶液濃度40.2重量%) 19.5 gにメタノール 145. 3gで磐駅後、2%硝酸水溶液30. 3gを添 加し、30度の温度で5時間加水分解させて溶液を作成 した。この溶液35gにノルマルプロパノール54、8 g. プロピレングリコールモノメチルエーテル6.1 g. ブルッカイト型酸化チタンゾル(昭和電工製: 圏形 分號度10重量%、平均粒径15 nm. 板状) 12.6 8. アナターゼ型酸化チタンゾル (石原産業製酸化チタ ン: 固形分濃度20.5重量%、平均粒径5 n m. 球 状)4. 1gおよびオキシ塩化ジルコニウム (和光純菜 工業製)(). 6gを順次添加し、40度の温度で3時間 攪拌し、溶液1を得た。超音波洗浄した100×100 mmのガラス基板に溶液1を2cc滴下し、スピンコー **卜塗布し、鴬温で40分放置し、前記同様のスピンコー** トを3回繰り返し、マップル電気炉NF-215(山田 麾機製)にて500℃、3時間熱処理を行い、試料1を 得た。

36 【0019】実能例2

実施例1におけるオキシ塩化ジルコニウム(和光純業工 素製)の添加量を1.3 gとした他は、実施例1と同様 の方法で試料2を作成した。

【0020】実施例3

実施例1におけるオキシ塩化シルコニウム(和光純業工 素製)の添加量を1.98とした他は、実施例1と同様 の方法で試料3を作成した。

【0021】比較例1

メチルシリケート(コルコート社製メチルシリケート5 1. 溶液濃度50.9 重量%)1.08、エタノール4 8.1g、ブルッカイト型酸化チタンゾル(昭和電工製:固形分濃度10重置%。平均粒径15 nm. 板状) 5.6g およびジルコニウム(IV)アセチルアセトナート0.2g を混合し、25度の温度にて1時間搬針し、溶液2を得た。比較例1. 実施例1.2 および3の溶液作成後の液の状態を表1に示す。

[0022]

【表1】

9 宿波の状態 沈殿、桜里なく均 に混合

【0023】表1より、比較例1は、溶液中に沈殿物が あり、コーティング液としては不十分でったが、実施例 1~3の溶液については、沈殿、凝集ともになく均一に 混合されており、コーティング液として十分に使用でき 10 2%硝酸水溶液30 3gを添加し、30度の温度で5 るものである。

【0024】比較例2

真餡倒1におけるオキシ塩化ジルコニウム(和光純薬工 糞製)を添加していない他は、実施例1と同様の方法で 試料4を作成した。試料1.2,3および試料4の耐薬 品性試験を行った。耐薬品性試験は以下の要領で行っ た。 各試料を20%炭酸ナトリウム水溶液に48時間浸 した後、水洗浄し、外観(見た目)観察、スポンジにて 3回擦り後の外觀観察を行い表2の評価基準にて評価し

[0025]

【表2】

· · · .

見た目	スポンジ擦り後
〇: 喫水線なし	O:キズなし
△:喫水潟あり	△:キズ小~中
×: ハクリ	×:キズ大~ハクリ

【0026】試料1、2、3および試料4の耐薬品性試 殷結果を表3に示す。

[0027]

【表3】

		耐察品性	
試料	2r02添加量(%)	見た日	スポンジ
比較例2		Δ	X
実施例 1	10	Δ	$\overline{\Delta}$
実施例2	20	ि	Ō
実施例3	30	7 6	1 - 6- -

【0028】表3より、2r02が添加されていない比 較例2は、耐薬品性は不十分な性能を示した。しかしな がら、2 r Ozの添加量を増やしていくことにより、耐 薬品性は、良好な結果を示し、添加量20%以上では、 全く問題ない性能を示したことから無機酸化物である2 rOzの高分散な添加が、耐薬品性の向上に大きく寄与 していると考えられ、実使用環境において十分な性能を 発揮できると考えられる。

【0029】実施例4

エチルシリケート(コルコート社製エチルシリケート4 0. 溶液濃度40.2重量%) 19.5gにメタノール 145.3gで鶯釈後、2%硝酸水溶液30.3gを添 加し、30度の温度で5時間加水分解させて溶液を作成 した。この溶液18、7gにノルマルプロパノール5

0.3g、ジエチレングリコールモノメチルエーテル1 2. 6g、ブルッカイト型酸化チタンゾル(昭和電工 製:固形分濃度10重置%。平均粒径15mm、板状) 11.3gおよびアナターゼ型酸化チタンゾル(石原産 紫製酸化チタン: 固形分遣度20.5 重量%、平均粒径 5 n.m.、球状) 7.5 gを順次添加し、40度の温度で 3時間機拌し、溶液3を得た。メチルシリケート(コル コート社製メチルシリケート51、溶液濃度50.9重 置%) 19.58にメタノール145.3gで常釈後、 時間加水分解させた溶液を作成した。この溶液10gに イソプロピルアルコール??. 5gおよびオキシ塩化ジ ルコニウム(和光純菜工業製)(). 15gを順次添加 し、1時間の捌拌を行い溶液4を得た。セリア磨きを両 面縫した100×100mmのガラス蟇板に溶液3を2 c c 瀬下し、スピンコート塗布し、続けて溶液4を2 c c滴下し、スピンコート塗布した。その後、恒温槽AD F-31 (ヤマト化学製) にて50℃、3時間予備熱処 **踵を行い、マッフル電気炉NF-215(山田電機製)** 20 にて520℃、30分熱処理を行い、試料5を得た。

【0030】比較例3

実施例4におけるオキシ塩化ジルコニウム(和光純業工 棠製)を添加していない他は、箕施倒4と同様の方法で 試料6を作成した。実施例4および比較例3にて作成し た試料5 および6の試料を用いてBLBランプにより紫 外線照度 1 0 μ w / c m' の照射を行い、経過時間と接 触角の変化を調査した。結果を図lに示す。これまでT 1 〇, + S i 〇, 系への2 r 添加による耐久性の向上は確 認されていたが、今回の図1の結果から、2 r 添加によ 30 り繁外線に対する感度の向上が確認できた。以上のこと から室内のような紫外線量が限られた場所であるととも に洗面所、浴室 キッチン等の薬品による耐久性が要求 される場合への展開が可能になると考えられる。

【0031】実施例5

エチルシリケート(コルコート社製エチルシリケート4 0. 溶液濃度40.2重量%) 19.5gにメタノール 145. 3gで着駅後、2%硝酸水溶液30. 3gを添 加し、30度の温度で5時間加水分解させて溶液を作成 した。この溶液16.7gにノルマルプロパノール5 40 0.3g、ジエチレングリコールモノメチルエーテル1 2. 6 g、ブルッカイト型酸化チタンゾル(昭和電工 製: 固形分濃度10 重量%、平均粒径15 nm、板状) 11.3gおよびアナターゼ型酸化チタンゾル(石原産 楽製酸化チタン:固形分波度20.5重置%、平均粒径 5 n m、球状) 7. 5 g を順次添加し、40度の温度で 3時間撹拌し、溶液5を得た。メチルシリケート (コル コート性製メチルシリケート51、溶液濃度50.9重 置%) 19.58にメタノール145.3gで盤状後、 2%硝酸水溶液30.3gを添加し、30度の温度で5 50 時間加水分解させた溶液を作成した。この溶液10gに

(7)

特開2000-160056

イソプロピルアルコール53.7gおよびオキシ塩化ジ ルコニウム(和光純菜工業製)(). 15gを順次添加 し、1時間の捌拌を行い溶液6を得た。セリア磨きを両 面餡した100×100mmのガラス基板に溶液5を2 cc滴下し、スピンコート塗布し、続けて溶液6を2c c滴下し、スピンコート盤布した。その後、恒温槽AD F-31 (ヤマト化学製) にて50℃、3時間予備熱処 理を行い、マップル電気炉NF-215(山田電機製) にて520℃、30分熱処理を行い、試料7を得た。 【0032】比較例4

11

実施例5におけるオキシ塩化ジルコニウム (和光純薬工 雲製)を添加していない他は、実施例5と同様の方法で 試料8を作成した。鉛筆硬度測定は、鉛筆硬度試験機N P-1 (泉洋精機製)を用いて測定した。測定結果を表 4に示す。

[0033]

【表4】

	Zr02添加量(%)	鉛筆硬度
実験例5	30%	9 H
比較例4	0%	6 H

*【0034】上記より、固形分濃度が同じような場合に おいて2 r添加した場合に鉛筆硬度が向上している。こ れは、2㎡イオンがSIの脱水縮合反応を促進させため に機械的強度が向上したと考えられる。よって耐久性と して摩擦等により真使用レベルで使用が制限されていた 領域での使用の可能性が十分にあると考えられる。

[0035]

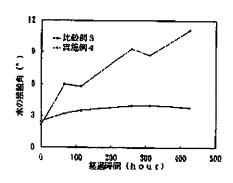
【発明の効果】本発明は、水系光触媒分散ゾルに無機酸 化物が契集・沈澱なく高分散化されたコーティング組成 10 物を提供することにより、良好な塗工性が得られ、該当 コーティング組成物の被膜が形成された基材の歩留まり は向上し、機械的強度、耐薬品性、光に対する感度の向 上により、真使用環境で制限されていた領域への利用展 関が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 紫外線照度10μw/cm²の照射における 経過時間と接触角の関係を示す。

***2**9

[図1]



フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

Fi

5-7フード (参考)

C 0 9 D 183/04 C 0 9 K 3/18 C 0 9 D 183/04

C09K 3/18

(72)発明者 底田 宏二

福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1香1

号 原陷機器株式会社内

(72)発明者 平河 智博

福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1

号 原陷被器株式会社内